4P022

Ni⁺(NH₃),の赤外光解離スペクトルと配位·溶媒和構造

(九大院理¹・分子研²) ○今村 俊貴¹, 大橋 和彦¹, 佐々木 潤¹, 井上 和哉¹, 十代 健², 西 信之², 関谷 博¹

【序論】溶液中における金属イオンの化学反応において,金属イオンは周囲の溶媒分子に取り囲ま れたクラスターとしてふるまい,溶媒効果を受けながら反応が進行する.生体分子は生体中すなわち 水が豊富な環境において機能することから,金属タンパク等の機能を理解するためには金属イオン の溶媒和に関する情報をクラスターレベルで得ることが重要である.また,特異性や選択性が極めて 高い生体内反応と,クラスターイオンの構造がどのように関わるのかという点は非常に興味深い.気 相中の溶媒和金属イオンクラスターに対して,溶媒-溶媒間の水素結合生成に敏感な振動分光法 を適用することによって,金属イオンの溶媒和構造に関する詳細な情報を得ることができる.本 研究では,Ni⁺(NH₃)_nの赤外分光を行ってその配位構造を決定し,配位・溶媒和構造を支配する 要因について考察した.

【実験と計算】超音速ジェット法とレーザー蒸発法を組み合わせることにより,Ni⁺(NH₃)_nを生成した.タンデム型四重極質量分析装置と光パラメトリック発振による赤外光を用いて,質量選別–光解離分光法によりNH伸縮振動領域の赤外スペクトルを測定した.また,Ni⁺(NH₃)_nの安定構造と赤外スペクトルを予測するために密度汎関数理論(DFT)計算を行った.

【結果と考察】図1に、金属原子のd軌道ならびにz軸方向から接近するNH₃分子を示す.

金属イオン–NH₃分子間の結合は、イオン–双極子間の引力と交換反 発力のバランスに支配される.金属原子のd軌道とN原子の孤立電子 対との重なりは、 $d\delta(xy) = d\delta'(x^2-y^2) < d\pi(yz) = d\pi'(zx) < d\sigma(z^2)$ の順 で大きくなるので、d軌道に分裂が生じ、軌道エネルギーもこの順序と なる. a軌道が満たされた場合(d^{10})、全d電子密度分布は球対称となり、 NH₃分子が配位する方向に異方性はないはずである.しかし、基底状 態の電子配置が3 d^9 のNi⁺では、n = 1において d_z^2 軌道がSOMOとなる ため全d電子の空間分布にはz軸方向の 2 ヶ所に密度の低い領域が 生じる.そこでNH₃分子は交換反発を避けるために、z軸方向から配位 する.n = 1, 2 については、そのような配位構造が最安定であることが DFT計算により確かめられた.一方、n = 3 については、n = 1, 2とは 異なり、 d_z^2 軌道のドーナツ状のローブに由来する低電子密度の領域 に向かってxy平面上の3方向から配位する構造が最安定となる.



Z軸方向から接近するNH₃分子

図 2 に、Ni⁺(NH₃)₄の光解離スペクトルおよびDFT計算による安定構造と計算スペクトル(4I- 4III) を示す. 2 配位構造を核とする(2+2)型の 4IIIには、2900cm⁻¹付近に特徴的な吸収が予測されて いるが、実測スペクトルには対応する吸収帯がみられないことから、4IIIの寄与は無視できる ほど小さい. 3000-3200cm⁻¹領域にみられる水素結合NHによる弱い吸収は、3 配位構造を核とす る(3+1)型の4IIに帰属される. この吸収と比較して、3300-3450 cm⁻¹領域のフリーNHによる吸収は強 く、4IIのみが存在すると考えた場合には、実測の相対強度を説明できない. そこで、水素結合をもた ない(4+0)型の 4Iが多く存在し、フリーNHの吸収強度に寄与していると解釈した. また、DFT計算によ っても4Iが最安定構造となった. 計算によると、n = 1-3においてSOMOであった3 d_2^2 軌道ではなく、 3 $d_x^2 - y^2$ 軌道が4IのSOMOになっている. そのため、x及びy軸方向の4ヶ所に低電子密度の領域が 生じ、そこにNH₃ 4 分子が配位するために 4Iは平面 4 配位型となる. このように、全d電子密 度分布の異方性が、Ni⁺の配位構造を決定していることがわかった.

図3に, n=4-8の光解離スペクトルおよびn=4-6の4配位構造についての計算スペクトルを示 す. n = 5の実測スペクトルには、3100-3300cm⁻¹に明瞭な吸収が観測される. これを含めたスペ クトル全体の特徴がn = 5-8においてほとんど変化しないことから, Ni⁺(NH₃)₅₋₈は共通の配位 構造を持つと考えられる. 特に, n = 5および6については、4Iを核とした(4+1)および(4+2) 構造についての計算スペクトルと実測スペクトルとの間に良い対応が見られる. これらのこ とから, Ni⁺(NH₃)_nにおいては、5番め以降のNH₃分子が第2溶媒和圏を形成して溶媒和が進行 することが分かった.

